ляет собой своего рода конденсат. Основанием для этого служит, вопервых, то, что трансляционно неинвариантный вакуум алгебр КАСи КПС является неинвариантным также относительно фазовых преобразований, что означает существование аномальных функций Грина, отличных от 0, и приводит к образованию конденсата [3]. Во-вторых, расчет моделей фермионных полей у методом среднего поля, роль которого играет вакуумное поле ф, также приводит к описанию последнего как конденсата. Задание хиггсовского поля как конденсата былопредложено в модели так называемых «техникварков», однако там онвводился изначально и строился из вспомогательных нолей [4].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

[1] Гриб А. А. Проблемы неинвариантности вакуума в квантовой теории поля. М.: Атомиздат, 1978. [2] Диксмье Ж. С*-алгебры и их представления. М.: Мир, 1974. [3] Боголюбов Н. Н. Вкн.: Статистическая физика и квантовая теория поля. М.: Наука, 1973, с. 7—80. [4] Ellis J. Phenomenology of unified gauge theories. — Preprint TH-3174-CERN, 1981.

Поступила в редакцию 02.12.82

ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 3. ФИЗИКА. АСТРОНОМИЯ, 1983, Т. 24, № 4

УДК 621.315.592

ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЛОВУШЕК В АМОРФНОМ ГИДРИРОВАННОМ КРЕМНИИ МЕТОДОМ ВОЛЬТ-ФАРАДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

А. Н. Невзоров, Ю. А. Зарифьянц, В. О. Абрамов, В. Е. Дрозд

(кафедра общей физики для химического факультета)

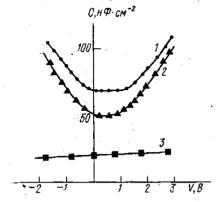
Одним из перспективных фотопреобразователей солнечной энергии: на основе аморфного гидрированного кремния (a-Si:H) является диод Шоттки [1]. КПД этого прибора зависит от характеристических длин материала (диффузионной и дрейфовой длины, ширины области пространственного заряда) и формы барьера Шоттки, в значительной мереопределяющихся плотностью и сечениями захвата локализованных электронных состояний в щели подвижности. В настоящей работе для параметров нами исследовались низкочастотные определения этих вольт-фарадные характеристики (ВФХ) барьера Шоттки позволяющие оценивать параметры ловушек вблизи уровня

Пленки a-Si: Н n-типа толщиной 0,8 мкм наносились при разложении моносилана в тлеющем ВЧ-разряде на покрытые слоем хрома кварцевые пластины. Для формирования барьера Шоттки на поверхность пленки перед напылением палладиевого электрода наносился слой Cr₂O₃ толщиной 30 Å методом молекулярного наслаивания [3]. ВФХ измеряли путем фазового выделения сигнала адмиттанса [4].

Температура измерений 293 К.

На рис. 1 приведены типичные ВФХ наших структур, измеренные при различных частотах (f) тестового сигнала. Следует отметить, что нам впервые удалось в экспериментах на таких пленках наблюдать рост емкости на фиксированной частоте $(f=1\ \Gamma_{\rm H})$ как при прямом, так и при обратном смещении диода. Именно такой вид низкочастотных ВФХ и был теоретически предсказан в работе [5]. Возрастание емкости при обратных смещениях обусловлено тем, что глубокие ловушки в

области пространственного заряда успевают перезарядиться, если частота f не слишком велика. Наоборот, при достаточно высокой частоте основной вклад в емкость дают электроны, захватывающиеся на ловушки вблизи уровня Ферми в объеме. Из анализа ВФХ, снятой при частоте 10 Γ ц, по приближенному соотношению $d(C^{-2})/dV = 2(e_{E}e_{0}N_{F})^{-1}$ (ϵ — диэлектрическая проницаемость) была определена плотность состояний на уровне Ферми $N_{F}=1.5\cdot 10^{17}$ см⁻³ · $9B^{-1}$. Это значение является типичным для пленок a—Si:H, изготовленных в данном технологическом режиме, и совпадает с оценками, сделанными для тех же образцов фотоэлектрическими методами [6].



C, H \Pi \ CM^{-2}

100

2
4
6
f, \(\text{f} \)

Рис. 1. Вольт-фарадные характеристики структуры $Pd-Gr_2O_3-a-$ Si:H-Cr, измеренные на частотах I (1), 2 (2) и 10 (3) Гц. Положительное напряжение соответствует прямому смещению диода

Рис. 2. Зависимость емкости от частоты для структуры Pd— Cr_2O_3 —a—Si:H—Cr при нулевом напряжении смещения (сплошная кривая — расчетная)

Для оценки кинетических параметров локализованных состояний исследовались частотные зависимости емкости диода при нулевом смещении (рис. 2), которые затем были сопоставлены с теоретическим соотношением из работы [7]:

$$C(f) = \frac{\varepsilon}{L_0} \left\{ 1 + \ln \left[\frac{eV_B}{kT \left(1 + \ln \left(f_0/f \right) \right)} \right] \right\}^{-1},$$

где L_0 — дебаевская длина экранирования, V_B — высота потенциального барьера, f_0 — верхняя граничная частота перезарядки ловушек в области пространственного заряда. Для $L_0 = 0.18$ мкм и $V_B = 0.1$ эВ была построена расчетная кривая (сплошная линия на рис. 2), которой $f_0 = 6$ Гц. С другой стороны, время термического выброса электрона из ловушки с энергией E в делокализованное состояние $\tau = (kT \rho_c v_i S)^{-1} \exp \left[(E_c - E)/kT \right]$, где E_c — энергия дна зоны проводимости, ρ_c — плотность состояний на дне зоны проводимости, v_t — тепловая скорость электрона, S — сечение захвата электрона ловушкой. На основе измеренных температурных зависимостей проводимости пленок $a ext{-Si:H}$ было определено положение уровня Ферми E_F в объеме E_c — E_F =0,57 эВ. Приняв ρ_c =10²¹ см⁻³ эВ⁻¹ [7] и считая, что τ = f_0 ⁻¹, можно оценить значение S из приведенного выше соотношения. Для всех исследованных образцов эта величина составляла К таким же результатам приводили и прямые измерения эффективного времени релаксации фототока в наших пленках при низком уровне возбуждения $(5 \cdot 10^{12} \text{ квант cm}^{-2} \cdot \text{c}^{-1})$, когда смещение квазиуровня Ферми не превышало kT и установление электронного равновесия лимитировалось выбросами из ловушек вблизи равновесного уровня Фермитировались в поставительного установания в поставительного учественного учественного

ми. Близкие значения S в a-Si:H приведены в работе [8].

Следует заметить, что использованное нами соотношение было получено для системы с моноэнергетическим уровнем. Однако наличие медленно меняющегося логарифмического члена делает оправданным усреднение по энергетическому распределению ловушек, свойственному a-Si: H, и введение эффективного уровня, адекватно описывающего процесс захвата и выброса электронов из локализованных состояний.

В заключение отметим, что промежуточный слой Cr_2O_3 , полученный по методу [3], не приводил к изменениям энергетического спектра ловушек a-Si: H, как показали контрольные опыты с образцами без такой пленки. Поэтому нанесение туннельно-тонких слоев окислов перспективно для улучшения характеристик диодов Шоттки на основе a-Si: H.

Авторы выражают благодарность А. Г. Казанскому за помощь в изготовлении образцов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

[1] Anderson D. A., Moddel G., Paul W. J. Electr. Mat., 1980, 9, N I., p. 141. [2] Spear W. E., Le Comber P. G., Sneel A. J. Phil. Mag., 1978, 38, p. 303. [3] Алесковский А. Б. Стехнометрия и синтез твердых соединений. Л.: Наука, 1976, с. 51—67. [4] Белотелов С. В., Сурис Р. А., Федоров В. Н. Приб. и техи. эксперимента, 1978, № 1, с. 216. [5] Goodman N. В., Fritsche H. Phil. Mag., 1980, 42, N 1, p. 149. [6] Гордеев С. Н., Зарифьянц Ю. А., Казанский А. Г. В кн.: II Республ. конф. по фотоэлектрич. явлениям в полупроводниках. Киев, 1982, с. 96. [7] Viktorovitch Р., Moddel G. J. Appl. Phys., 1980, 51, N 9, p. 4847. [8] Abbles B. et al. Solid State Comm., 1982, 41, N 3, p. 251.

Поступила в редакцию 03.12.82

ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 3. ФИЗИКА. АСТРОНОМИЯ, 1983, Т. 24, № 4

УДК 621.375.826

ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРА ГЕНЕРАЦИИ ТЕА СО₂-ЛАЗЕРА С ВНУТРИРЕЗОНАТОРНЫМ ПОГЛОТИТЕЛЕМ

А. Б. Васильев, А. И. Федосеев

(кафедра оптики и спектроскопии)

Одним из важных направлений исследований CO_2 -лазеров в последние годы стало получение генерации на переходах с высокорасположенных колебательных уровней — на так называемых полосах секвенции и «горячих» переходах. Вовлечение в процесс генерации таких переходов наряду с основным лазерным переходом 00^01-10^00 (длина волны $\lambda=10,6$ мкм) молекулы CO_2 приводит к существенному росту мощности лазера и позволяет повысить эффективность съема энергии с мощных CO_2 -усилителей на 20-40% [1]. С другой стороны, для эффективного усиления коротких импульсов излучения, длительность которых сравнима с временем вращательной релаксации, необходимо, чтобы спектр генерации состоял из нескольких колебательно-вращательных линий [2]. В работе [3] сообщалось о реализации режима работы TEA CO_2 -лазера, в котором генерация происходила одновременно на первой (00^01-10^00) и второй (00^02-10^01) полосах секвенции.